

特定施設における有害物質の使用等について * 有害物質：水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する物質

1. 使用等をしている。

	有害物質の種類	該当物質 (○を記入)	使用等の方法(該当項目に○をつける)
1	カドミウム及びその化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
2	シアン化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
3	有機燐化合物(パラチオン,メチル パラチオン,メチルジメトン及びEPN に限る)		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
4	鉛及びその化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
5	六価クロム化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
6	砒素及びその化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
7	水銀及びアルキル水銀その 他の水銀化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
9	トリクロロエチレン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
10	テトラクロロエチレン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
11	ジクロロメタン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
12	四塩化炭素		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
13	1・2-ジクロロエタン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
14	1・1-ジクロロエチレン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
15	1・2-ジクロロエチレン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
16	1・1・1-トリクロロエタン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
17	1・1・2-トリクロロエタン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
18	1・3-ジクロロプロペン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
19	チウラム		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
20	シマジン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
21	チオベンカルブ		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
22	ベンゼン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
23	セレン及びその化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
24	ほう素及びその化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
25	ふっ素及びその化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
26	アンモニア, アンモニウム化 合物, 亜硝酸化合物及び硝 酸化合物		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
27	塩化ビニルモノマー		製造 使用 処理 貯蔵 その他()
28	1・4-ジオキサン		製造 使用 処理 貯蔵 その他()

注)

「製造」 当該特定施設において有害物質を製品として製造すること

「使用」 当該特定施設において有害物質をその施設の目的に沿って原料, 触媒等として使用すること

「処理」 当該特定施設において有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去すること

2. 使用等をしていない。